# 磁気的純化されたエルビウム希薄添加酸化物結晶の作製と光物性 —— 量子情報操作プラットフォームをめざして

希土類元素であるEr(エルビウム)は通信波長帯光子による量子情報操作のプラットフォームとして期待されています.しかしEr添加母体結晶の 高品質エピタキシャル成長が困難なことや量子操作の性能を決定する量子 情報の保持時間が理論的に予測されるものよりはるかに短いことなどが問 題でした.本稿ではErの母体結晶として相性の良い希土類酸化物,特に量 子情報保持時間の短寿命化の主要因である核スピンを除去(磁気的純化) した母体酸化物結晶(CeO<sub>2</sub>:酸化セリウム)に着目し,その薄膜のSi基板 上への高品質エピタキシャル成長と光学的性質について紹介します.

<sup>たわら</sup>	たけひこ	ぃ <sub>なば</sub>	2803
	<b>毅彦</b>	/稲葉	<b>智宏</b>
NITT物性科学其礎研究所			

## Er希薄添加酸化物とその量子状態 操作プラットフォームとしての応用

均一な固体結晶中に添加された希土 類原子は、母体材料の違いなどの外部 環境や温度に左右されない確定的、離 散的かつ揺らぎの少ない理想的なエネ ルギー量子準位を形成することが古く から知られています. これは希土類原 子特有の電子配位, すなわち外界から 電気的に遮蔽された4f電子軌道を有 するためです.近年このような優れた 希土類原子の量子準位を、量子情報通 信における量子情報操作デバイスのプ ラットフォーム,特に光量子メモリ等 へ応用する研究がさかんに行われてい ます. ここで量子情報操作とは、量子 情報の伝達を担う光子をいったん物質 中の電子に転写し、その電子状態に何 らかの演算を加え、再びその情報を持 つ光子として放出するものです. この とき情報が転写される物質の電子状態 (量子準位)は、エネルギー的な揺ら ぎが小さい (量子情報を失うまでの時 間が長い)必要があります。この要請 を満たす物質として希土類原子は優れ ているのです。特に希土類元素の1つ であるEr(エルビウム)は唯一通信 波長帯光(波長1.55 µm)との相互作 用が可能です.そのため既存の光ファ イバ網を用いた量子光通信を考えた場 合,量子情報操作デバイスのプラット フォームとしてEr添加結晶は非常に 有望であるといえます<sup>(1)</sup>.

では具体的にどのようなEr添加結 晶が求められるでしょうか.まずEr は"希薄"に添加される必要がありま す。その理由は添加されたEr原子ど うしの距離が近いとEr原子間でエネ ルギー、つまり量子情報のやり取りを してしまい. 瞬時に情報を失ってしま うからです<sup>(2)</sup>. そのため十分にEr原 子間の距離を離す(希薄化する)必要 があります.またErを添加する母体 結晶は、Erの量子準位の形成、特に 量子準位の揺らぎの程度に強く影響を 与えます。例えば母体結晶を構成する 各原子が核スピンを持つ場合、大きな 磁気的揺らぎが発生し、量子準位の揺 らぎは大きくなります. これも量子情 報を短時間で失ってしまう要因です. さらに効率的な量子情報操作をするた めには、母体結晶に光を強く閉じ込め Erとの相互作用を高める必要があり ます. これにはSi (シリコン) フォト ニクスで培われてきた光回路(光共振 器、導波路、合波・分波デバイス等) 作製技術が有用です。そのため母体結

晶はSi基板上に薄膜として形成され ることが望まれます.

このような磁気的揺らぎが少なく. かつSi基板上に薄膜として結晶成長 可能な材料候補として希土類酸化物薄 膜があります. 希土類酸化物の結晶構 造はSiと同じ立方晶構造をとり、しか もその格子定数がSiのちょうど2倍 に一致します. これはSi基板上にエピ タキシャルに成長できる可能性がある ことを示しています。さらに数多くあ る希土類原子の中でもCe(セリウム) は、唯一核スピンを持ちません(図1). すなわちCeは磁気的揺らぎがなくEr の量子状態に影響を与えない優れた特 徴を持ちます. ちなみに酸素も核スピ ンを持つ同位体の天然存在比は非常に 小さいため、希土類酸化化合物である CeO<sub>2</sub>(酸化セリウム)がSi基板上で のEr添加母体結晶としてもっとも有 望であるといえます. しかしCeO2は 研磨剤や還元触媒などとして研究され てきた物質であるものの<sup>(3)</sup>, これまで 量子情報操作プラットフォームをめざ したErの添加母体結晶として、かつ Si基板上のエピタキシャル結晶薄膜 としての研究例はありませんでした.

## Er希薄添加CeO₂薄膜の結晶成長

Er希薄添加CeO<sub>2</sub>はMBE (Molecular Beam Epitaxy:分子線エピタキシー) 法を用いて、表面が清浄化されたSi (111) 基板上に640 ℃で30 nmの膜厚 で成長しました<sup>(4)</sup>.また希土類原料は 高純度 (>99.99%) のErおよびCe金 属を用い、O\*(酸素原子ラジカル) で酸化することにより希土類酸化膜を 成膜しました. 添加母体となるCeO, の高品質結晶を得るためには、形成さ れた薄膜が化学量論的組成(ストイキ オメトリ、今の場合Ce: O=1:2) を持つように、CeとO\*の供給比を調 節する必要があります. そのため一定 の0\*供給量の下, Ceの供給量を変化 させ結晶品質を調べました.結晶成長 後 のRHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction:反射高 速電子回折)を図2に示します. Ce 供給量が少なく酸化力が過剰な場合 (図 2 (a), (b)) ではアモルファス状態 を示すハローパターンを、またCe供 給量が多く酸化力不足となっている場 合(図2(d), (e))では多結晶状態を 示すリングパターンが現れています. 一方で図2(c)では表面が平坦かつ単 結晶成長していることを示すストリー クパターンが観察され、このCe供給 量でストイキオメトリに近い薄膜が形 成されていることが分かります. また このCe/O\*供給比を一定に保ったま ま、それぞれの供給量を増やした場合 (図2(f)) においても、ストリークパ ターンが維持されることも分かりまし た. このため, Erを希薄添加する際に, 母体CeO。結晶の結晶成長速度を変え ることによって、結晶品質は一定に 保ったまま, Er濃度を変化させるこ とができます.





CeO<sub>2</sub>には私たちがターゲットとし ている立方晶fluorite構造CeO<sub>2</sub>だけで なく、立方晶bixbyite構造Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>や六 方晶構造などの複数の結晶構造が存在 します.上記のRHEEDではこの結晶 構造の違いまでは判別できないため、 X線回折法(XRD)とX線光電子分光 法(XPS)を用いて、結晶構造をさ らに詳細に調べました.図3(a)の XRDスペクトルから見積もられる結 晶格子間隔は3.11 Å(オングストロー ム)\*となり、これは立方晶CeO<sub>2</sub>に一 致し、六方晶構造は存在しないことを 示しています.さらに結晶が均一かつ 原子レベルで平坦に成長できている際 に観測される周期的なサテライトピー クの間隔から、成長した酸化セリウム の膜厚が26.4 nmであることが分かり、 これは想定した成長膜厚とほぼ一致し ます.また図3(b)のCe 3d軌道のXPS スペクトルから見積もられるCe原子 の荷電状態はすべてfluorite構造CeO<sub>2</sub> の場合のCe<sup>4+</sup>であり、bixbyite構造 Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の場合のCe<sup>3+</sup>は存在しないこと を示しています.以上のことから成長 したCeO<sub>2</sub>薄膜は所望の立方晶fluorite 構造のCeO<sub>2</sub>であることが実証されま した.

\* オングストローム:原子,分子の大きさや,可視 光の波長などを表わす長さの単位.1 Å=10<sup>-10</sup> m





成長したEr添加CeO<sub>2</sub>の断面TEM (Transmission Electron Microscopy: 透過型電子顕微鏡)像を図4に示しま す.この結果から,表面が非常に平坦 であることに加え,結晶欠陥や異なる 結晶構造相のない非常に結晶品質の高 いEr添加CeO<sub>2</sub>薄膜結晶が得られてい ることが分かります.このように高品 質Er添加CeO<sub>2</sub>の薄膜結晶のSi基板上 へのエピタキシャル成長が初めて実現 されました.

### Er添加CeO₂薄膜結晶の光学特性

高品質Er添加CeO<sub>2</sub>薄膜結晶の光学 特性について調べました.PL(Photoluminescence:フォトルミネッセンス) の励起波長依存性のカラープロットを 図5に示します.PL測定は試料へレー ザ照射することでエネルギーを与え試 料中の電子を高いエネルギー(励起) 状態に遷移させ,この励起電子が低い エネルギー状態に戻るときに発する光 を観測するものです.ここでは添加 Er濃度は4%(図5(a))から1%(図 5(c))まで変化させ,温度4Kで測定 しています.いずれのEr添加濃度に





おいても、励起波長(縦軸) 1512 nm に対してPL波長(横軸) 1533 nmに 鋭い発光が出現していることが分かり ます.これは希薄添加されたEr原子 が母体CeO2結晶中のCeサイトを確か に置換するとともに光学的に活性化し ていることを表しています.言い方を 変えれば、このEr濃度範囲ではEr原 子が結晶格子間に存在したりErクラ スタを形成したりしていないことを意 味しています.複数の発光ピークが現 れているのは、CeO2母体の持つ結晶 場により添加Erのエネルギー準位が 分裂しているからです.

この発光スペクトルを詳細に比較し たものが図6(a)です.いずれのEr濃 度においても同じ波長に発光ピークが 現れていると同時に,Er濃度が低く なるほど発光強度は増大しています. これはEr濃度が低くなるにつれEr原 子どうしの距離が離れ母体結晶中で孤 立化することで,Er-Er原子間相互作 用によるエネルギー移動を伴う非発光 過程が抑制される(発光効率が増強さ れる)ためです.この添加Erの希薄 化による非発光過程の抑制は発光寿命 にも変化をもたらします.発光寿命の Er濃度依存性を図6(b)に示します.

発光寿命は照射する励起レーザをパル ス化し、レーザ照射後に現れる試料か らの発光の強度変化を時間領域で測定 するものです(図6(b)の挿入図).図 6 (b)からEr濃度の減少に伴い発光寿 命が長寿命化しているのが分かりま す. また図中の点線はこれまでに量 子光学結晶として用いられてきた YSi<sub>2</sub>O<sub>5</sub>母体結晶に0.001%の極希薄Er を添加したときの発光寿命(約11 ms) を示していて、Er-Er原子間相互作用 を無視できる固体中のErの真の発光 寿命と考えられます. 今回用いたEr 添加CeO2ではEr最低濃度が1%でし たが、あと一桁程度添加濃度を下げる ことでEr-Er間相互作用を完全に抑制 し、Er原子を固体中で完全に孤立化 させることができると考えられます. このように発光特性においても、確定 的なエネルギー状態の形成やEr濃度 低下による発光効率の増強と寿命の長 寿命化などが観測され、結晶構造的だ けでなく光学特性的にも高品質なEr 希薄添加CeO₂薄膜を得ることに成功 しました.

#### 今後の展開

今回得られた高品質Er希薄添加

CeO<sub>2</sub>薄膜では量子情報の保持時間が 従来の添加母体結晶に比べ長寿命化し ていることが期待されます.今後結晶 表面に光導波路構造等を作製すること により,この保持時間を評価するとと もに通信波長帯光によるオンチップで の量子状態操作の実現をめざします.

#### ■参考文献

- T. Tawara, H. Omi, T. Hozumi, R. Kaji, S. Adachi, H. Gotoh, and T. Sogawa: "Population dynamics in epitaxial Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thin films grown on Si(111)," Appl. Phys. Lett., Vol.102, No.24, 241918, 2013.
- (2) T. Tawara, Y. Kawakami, H. Omi, R. Kaji, S. Adachi, and H. Gotoh: "Mechanism of concentration quenching in epitaxial (Er<sub>\*</sub>Sc<sub>1</sub>, <sub>x</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thin layers," Opt. Mat. Express, Vol.7, No.3, pp.1097-1104, 2017.
- (3) E. J. Schelter: "Cerium under the lens," Nat. Chem., Vol.5, No.4, p.348, 2013.
- (4) T. Inaba, T. Tawara, H. Omi, H. Yamamoto, and H. Gotoh: "Epitaxial growth and optical properties of Er-doped CeO<sub>2</sub> on Si(111)," Opt. Mat. Express, Vol.8, No.9, pp.2843-2849, 2018.



(左から) 稲葉 智宏/ 俵 毅彦

希土類原子は私たちの周りでさまざまな かたちで利用されていますが、その量子光 学応用は比較的新しい研究分野です。希土 類原子の持つユニークな特徴がどのように 活かされ、この研究分野がどこまで発展し ていくのかとても楽しみです。

#### ◆問い合わせ先

NTT物性科学基礎研究所 量子光物性研究部 量子光デバイス研究グループ TEL 046-240-3683 FAX 046-270-2342 E-mail takehiko.tawara.tn@hco.ntt.co.jp